PRODUCTION OF MAGNETIC DISK MEDIUM

Patent Number: JP61261820

Publication date: 1986-11-19

Inventor(s): YAMAZAKI HISASHI; others: 01

Applicant(s): FUJI ELECTRIC CO LTD

Requested Patent: JP61261820

Application Number: JP19850104383 19850516

Priority Number(s):

IPC Classification: G11B5/84; B24B21/04; G11B5/72

EC Classification:

Equivalents:

Abstract

PURPOSE:To obtain a magnetic disk medium having the excellent smoothness and lubricity of a surface by removing the microprojections existing on the surface of a magnetic film formed on a nonmagnetic substrate then forming a protective lubricating layer thereon, polishing the surface and providing ruggedness to the surface by means of a tape having prescribed roughness and abrasive grains.

CONSTITUTION: The magnetic film of the medium is first subjected to tape burnishing for removing the microprojections from the surface of said film by using a WA#6000 tape with a polishing device. The protective lubricating layer is then formed by coating a silicon solid lubricating agent thereon by using a solvent and baking the coating and thereafter the surface of the protective lubricating layer is subjected to tape polishing using a WA#6000-8000 tape with the polishing device to remove the projections from the surface of said layer by which the film thickness is adjusted. The lubricating layer is subjected to tape polishing using a WA#4000 tape as final finishing to provide ruggedness on the surface, by which the coefft. of friction and adsorption power on the surface are decreased.

Data supplied from the esp@cenet database - I2

19日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

⑫公開特許公報(A) 昭61-261820

@Int Cl.4

G 11 B

CONTRACT AND

識別記号

庁内整理番号

砂公開 昭和61年(1986)11月19日

5/84 21/04 G 11 B 24 В В

7314-5D 7512-3C 7350-5D

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

の発明の名称 磁気ディスク媒体の製造方法

5/72

创特 願 昭60-104383

侸

②出 頤 昭60(1985)5月16日

個発 明 者 Ш 崎

横須賀市長坂2丁目2番1号 株式会社富士電機総合研究 所内

79発 明 者 沢 永

Ŕß

横須賀市長坂2丁目2番1号 株式会社富士電機総合研究

所内

の出 願 人 富士電機株式会社

川崎市川崎区田辺新田1番1号

個代 理 弁理士 山口

- 発明の名称 磁気ディスク媒体の製造方法
- 特許請求の範囲

1) 非磁性基体上に形成した磁性層 表面に存在する 微小突起のみをバニッシング用テーブを用いて除 去したのち、保護潤滑閣を形成し、次に必要によ りポリシング用テープで保護潤滑層の所定の厚さ まで研摩し、次いで16000 より粗い砥粒を持つボ リシング用テープで最表面に凹凸を付けることを 特徴とする磁気ディスク媒体の製造方法。

発明の詳細な説明

【発明の属する技術分野】

本発明はコンタクト・スタート・ストップ (C SS)方式の磁気ディスク装置に用いられる磁気 ディスク媒体の製造方法に関する。

【従来技術とその問題点】

磁気ディスク媒体は磁気ディスク装置の記録媒 体として使用されるもので、その磁気ディスクを 所定の回転数で回転させ、磁気ヘッドをその磁気 ディスクの回転により生ずる空気流により所定間

隔で浮上させて磁気ディスク媒体に対して記録再 生を行う。この様な磁気ディスク装置においては、 先ず磁気ディスク媒体の回転の開始時と停止時に は磁気ヘッドが磁気ディスク媒体と接触するとい うコンタクト・スタート・ストップ方式が多く、 また磁気ヘッドが浮上しても磁気ディスクと磁気 ヘッドの浮上間隔は1ミクロン以下と非常に狭い ため、磁気ディスク媒体の磁性層表面に微小突起 があると磁気ヘッドとの接触による損傷が媒体表 面に見られ、媒体表面の高精度の平滑性と潤滑性 が要求されている。

従来、磁気ディスク媒体表面の平滑性と潤滑性 を良くするために種々の方法がとられている。平 滑性に関しては、磁気ディスク媒体上の微小突起 を除去するために、サファイア・ヘッドによるバ ニッシングが主に行われているが、この方法では 磁気ディスク全面を掃引し、敵小突起を除去する には時間がかかりすぎることと、ヘッドが当たら ない所では突起が除去できないこと、またヘッド が当たったとしても、磁性層表面に大きい突起や

---105---

- 1 -

- 2 -

強固な突起がある場合はヘッドが負けてしまい、 除去できないことが多い。また潤滑性に関しては、 バニッシングされた磁気ディスク媒体面に要面潤 滑性の良い液体または固体の潤滑剤を被覆するだ けなので、下地の突起の存在がなお大きく影響す る場合が多い。

この様な方法で仕上げ加工した磁気ディスク媒体表面ではCSS時に磁気ヘッドと突起との衝突により磁気ヘッドに大きな損傷を与えたり、衝突時に生じた破片などが磁気ディスク媒体自体に損傷を加えたりしてエラーの原因となっており、磁気ディスク媒体表面のさらに良好な平滑性および潤滑性を得る製造工程が望まれる。

【発明の目的】

本発明の目的は磁気ディスク媒体の磁性層表面に存在する微小突起を効率良く除去し、しかも被度された表面保護皮膜の膜厚を適正な値に調整しなから、平滑性、潤滑性を有する表面を形成する磁気ディスクの製造方法を提供することにある。
【発明の要点】

- 3 -

ッケル磁性膜を形成した。

次に第1図に示す構造のテープ研磨機を用いて 表面を加工した。 磁気ディスク媒体の円板 1 をタ ーンテーブル2に真空力によりチャックし回転さ せる。コンタクトゴムローラ3はローラアーム4 を介してエアシリンダ 5 に直結されており、この エアシリング 5 によってコンタクトゴムローラ 3 を介してポリシングテープ(またはバニッシング テープ) 6 と円板 1 との間に力を加え、実際には 30 mm 幅のポリシングテープ 6 を円板 1 に加圧する。 またローラアーム4には圧力ゲージが貼付されて おり、加圧力を常時検出しなから一定に保持する 機構となっている。テープ 6 は制動リール1より テンションローラ8、ガイドローラ9を介してコ ンタクトゴムローラ3に接し、さらにガイドロー う 9 . テンションローラ 8 を介してテープ走行ロ - う10を経て巻き取りリール11に巻き取られて、 コンタクトゴムローラ3を週週する時に円板1の 表面を仕上げ加工する。 テープの駆動はテープ走 行ローラ10によって行われ、このテープ走行ロー

【発明の実施例】

以下、本発明の実施例を図面に基づいて詳細に 説明する。外径 130 mm が、内径40 mm がのアルミニ ウム基板に厚さ約20ミクロンのニッケルりんめっ き皮膜を形成し、この皮膜を裏面研磨し、次に平 均あらさ0.05ミクロン以下に鏡面研磨した。この ニッケルりんめっき膜の上に厚さ0.05ミクロンの Cr膜を形成後、厚さ0.05ミクロンのコバルト・ニ

- 4 -

う10の回転数を変えることにより、走行スピードを変えることができる。加工時には流出管12から 研削液が加工面に供給される。

円板 1 . ターンテーブル 2 を除いた機構部は一体になっており、全体が上下でき、加圧力を解除したい時には、この機構部が上へ移動すれば、コンタクトゴムローラ 3 はフリー状態になる。また、この機構部全体はポリシング中、円板面に平行に移動(援動)でき、ポリシング中にこの動作も加えることで媒体要面の微小突起を有効に除去できる。

このようなポリシング装置を用いてHA86000 のテープを使用しターンテーブルを300rpmで回転して媒体の磁性膜表面の微小突起を除去するテープで、延粒粗さをHA86000 より粗くすると媒体表面に大きい摺動感がつくため、86000 以上でやることが望ましい。しかし又あまり細かくすると、媒体表面の微小突起の除去が効率的でなくなる。 体にシリコン系固体潤滑材を浄剤を用いて塗布、焼

特開昭61-261820(3)

する。この結果から、最終仕上げにより回転速度が遅くとも浮上性が良いことがわかる。 しかしこのような最終仕上げの効果は、研気ディスク媒体 製面の微小突起の除去をテープパニッシング以外 の方法、例えばサファイア・ヘッドによるパニッ シングで行った場合には見られなかった。

【発明の効果】

本発明によれば、磁気ディスク媒体の磁性層別面の微小突起の除去、媒体表面を被覆する保護剤清皮膜の必要により行う腹厚の調整、さらに摩摩の機関のための最表面凹凸の形成をすべなをの最大面凹凸の形成をするので、媒体の面がない。最近の平滑性および潤滑性の優れた磁気ディスク媒体を得ることができる。

4. 図面の簡単な説明

第1 図は本発明の実施例に用いるテーブポリシング装置の正面図、第2 図、第3 図は回転磁気ディスク媒体上に配置されたヘッドに取り付けた A

- 8 -

en e tretta

ポリシング時の効果をヘッドに取り付けたAB(アコースチック・エミッション)センサの出力によって評価した結果を第2図、第3図に示す。 第2図は保護潤滑層形成後、第3図は最終仕上げ後のABセンサ出力を示し、浮上が十分でないと

る前後で摩擦係数が0.3 ~0.4 から0.15~0.25へ

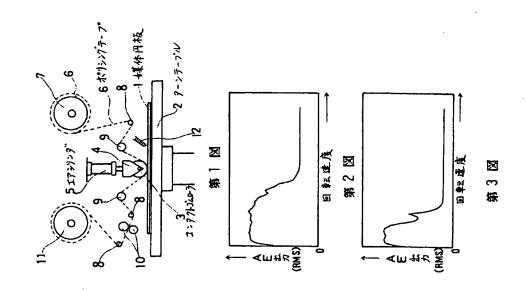
低下した。

E センサの出力と回転速度の関係線図で、第2図は本発明の実施例の保護潤滑層形成後、第3図は最終仕上げ後の測定結果を示す。

1: 媒体円板、2:ターンテーブル、3:コンタクトゴムローラ、5:エアシリンダ、6:ポリシングテープ(パニッシングテープ)。

代理人并理士 山 口 监





手続補正書(自発)

昭和60年 8月13日

特許庁 長 官

宇 贺 道 郎 殿



1.事件の表示

特願昭40-104383

2. 強 明の 名 称

磁质分11月煤煤

出願人

住 所

川崎市川崎区田辺新田1番1号 (523) 舊士 電機株式会社

. . .

(ほか 名)

4. 代 理 人

住 所 川崎市川崎区田辺新田1番1号

富士電機株式会社內

氏 名

(7514) 弁理士 山 口 巖 Tel. (044) 333-7111 (内線4564)



- 5. 補正指令の日付 昭和

6. 補正により増加する発明の数

7. 補 正 の 対 象 明知四の発明の詳細な説明の項

0.25」と訂正する。

1. 明細書第4頁第19行目に「0.05」とあるを「 デュ

化理人种理士 山 口



-108-